⑫公開特許公報(A) 平1-251747

⑤Int. Cl. 4 23/50 23/28 H 01 L

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)10月6日

G-7735-5F A-6412-5F

請求項の数 4 (全6頁) 審査請求 有

半導体装置およびその製造方法 会発明の名称

> 頤 昭63-78507 印符

> > 勉

司

啓

額 昭63(1988)3月31日 20出

明者 冗発

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工 場内

Ш 明 市 者 個発

何発

明 者 神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工

淳 鲆

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

株式会社東芝 の出 頭 人

大

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

外2名 弁理士 佐藤 — 雄 四代 理 人

叨

1. 免明の名称

半導体装置およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

半導体ペシットと、この半導体ペレット を載せるための所要の呼みをもったペッドと、前 記半導体ペレット内の素子と外部との間の接続を 行うためのリードと、前紀半導体ペレット、前記 ベッド、および前記リードの一部を構成するイン ナリード部を封止するモールド樹脂と、前記半導 体ペレットと前記インナリード部の一端とを接続 するポンディングワイヤと、を備える半導体装置 において、

前記ペッドの周辺上下線を、断面凸弧状に形成 したことを特徴とする半導体装置。

2. 請求項1記載の半導体装置の製造方法に おいて、ペッドの肩辺部のみが露出するようにレ ジストをパターニングし、話出部分のみをエッチ

ングして断面凸弧状に加工することを特徴とする 半導体装置の製造方法。

- 3. 錆水項1記載の半導体装置において、更 にインナリード部のポンディングワイヤとの接続 違の上下継をも、断面凸弧状に形成したことを特 徴とする半導体装置。
- 請求項2記載の半導体装置の製造方法に おいて、更にインナリード部の技統端部をも露出 するようにレジストをパターニングすることを特 徴とする半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(应集上の利用分野)

本発明は半導体装置およびその製造方法、特に 半導体装置内のリードフレームの構造およびその 加工方法に関する。

(従来の技術)

現在重産されている最も一般的な半導体装置は、 半導体ペレットと、この半導体ペレットを載せる

(発明が解決しようとする課題)

従来の半導体装置には、使用環境によってモールド制能内にクラックが発生するという問題点が あった。このような問題は、たとえば、1.

Fukuzawa etal.

[MOISTURE RESISTANCE

P ; 水蒸気圧 (kg/ml)

k ; 定数

であり、

左辺>右辺 のときはクラックが発生しない 安全領域

左辺<右辺 のときはクラックが発生する危 険領域

左辺=右辺 のときは両者の境界線 を示す(該文献第5間参照)。

しかしながら、現実的には、上述の判定式における安全領域の条件を満す半導体装置であっても、クラックの発生が認められ、製品の少留りを低下させる大きな問題となっている。そこで本発明は、 熱が作用する使用環境においても、モールド樹脂 内にクラックが発生することのない半導体装置お よびその製造方法を提供することを目的とする。 (発明の構成)

(課題を解決するための手段)

本免明は、半導体ペレットと、この半導体ペレットを載せるための所要の厚みをもったペッドと、

DEGRADATION OF PLASTIC LSI = REFLOW SOLDERING」
(IEEE/IRPS Vol. 9/85)
p. 192 (1985))において指摘されている。この文献によると、半導体装置のモールド樹脂内に吸収された水分(放文献第2図(a))に対して、実装時の無処理(放文献第1図(b))が加えられると、水分が蒸発するときの圧力によってモールド樹脂にクラックが発生する(放文献第2図(b))ことが示されている。また、このときの応力は、チャプサイズあるいはベッドサイズ、および樹脂の種類、序みによっ。て表わすことができるとされている。

 $\sigma = ax \le \ge 6 k (a^2/t^2) P$ (1)

σeax; 最大曲げ応力(kg/量)

a ; チップあるいはペッドのサイズ (mm)

t ; 初脂厚(mm)

半導体ペレット内の業子と外部との間の接続を行うためのリードと、半導体ペレットとリードとを 接続するポンディングワイヤと、これらを封止す るモールド樹脂と、を備える半導体装置において、 ペッドの周辺上下棘、およびリードのポンディン グワイヤとの接続端の上下継を、断面凸弧状に形 成したものである。

また、本免明は上述の半導体装置を製造する場合に、ベッドの周辺部およびリードの接続端部のみが話出するようにレジストをバターニングし、話出部分のみをエッチングして断面凸弧状に加工するようにしたものである。

(作用)

第9図および第10図は、従来の半導体装置の クラック発生は験結果を示すグラフである。各グ ラフにおいて、複雑はテストに使用した半導体装置のベッドの一辺の長さ (mm) を示し、緩軸は同 装置のモールド樹脂の厚み (mm) を示す。グラフ 上のプロットは、その連種位置が示す数値(ベッ ドの一辺の長さ、モールド樹脂の厚み)をもった 半導体装置に所定の温度を加えた場合に、クラックが発生するか否かを示す。ここで無丸は10個のサンプル中10個ともにクラックが発生したことを示し、白丸は10個のサンプルのいずれもクラックが発生しなかったことを示す。また、三角は10個のサンプルのうちの一部(通常、1~2例)にクラックが発生したことを示す。第9図は所定温度として215℃を2分間与えた場合の結果を示す。

前述の判定式(1)によれば、それぞれグラフに示すような境界線を境として、安全領域と危険領域とが定義でき、安全領域の条件を満たす半球体装置ではクラックの発生は理論的にはないはずである。ところが現実には、グラフの三角形のプロットで示す場合に、クラックが発生している。本類免明者は、このような安全領域におけるクラックの発生が、ベッドの周辺部およびインナリード部の先端部に、鋭利な部分があることに起因することを見出だしたものであり、この鋭利な部分に

辺部の上継および下継に鋭利部2aが形成され、 インナリード部31の接続端の上継および下縁に 鋭利部3aが形成されている点である。これらの 鋭利部は、リードフレームを製造する工程時に自 然に発生するものである。ところが、このような 鋭利部が存在すると、実装時に熱が加えられた場 合、この説利部から第3回に示すようにクラック 5 aが伸びるのである。第4 図は、ベッドの一辺 の長さが5mm、モールド樹脂の厚みが1.3mmの 従来装置に、215℃の温度を2分間加えた時に 発生したクラックの様子を示す図で、第3図の破 護部分の拡大図に相当する。本願発明者は、この クラック5aが鋭利部2aによって誘発させられ るものであると認識した。すなわち、この説利部 に内部応力が集中することにより、クラックが誘 免させられるものと考えられる。本願発明者は、 鋭利部の形成方向と発生するクラックの方向とに 相関関係があることを確めたのである。そこで、 第1凶に示すように、従来鋭利部が存在していた 部分に斯面凸弧状部20、30を形成したのであ 対して形状を滑らかにする処理を施すことにより、 安全領域におけるクラックの発生を抑制したもの である。

(実施例)

本発明の袋置

以下、本売明を図示する実施例に括づいて説明する。第1図は本売明の一実施例に係る半導体装置の断面図である。この装置の特徴は、第2図の従来装置の断面図と比較することにより明瞭になる。これらの装置は、いずれもませるためのが変にないったをもったペレットを栽せるためのがある。リード3はボンディングラインによって半導体ペレット1と電気があったがでは、リード3の一部を構成するインナリード部3にはモールド間5の外部にはアクタリード部32のみが話出する。

第2図に示す従来装置の特徴は、ペッド2の開

る。このように、鋭利部を断面凸弧状部とすることによって、従来安全領域において見られたクラックの発生を完全に抑制することができる。

、実施例の効果

50個の従来装置と50個の本願装置とを、同一の温度条件下におき、クラック発生率を測定した実験の結果を以下に示す。

22	皮	室温	215 °C	240℃	260 °C
従来	袋運	0/50	24/50	42/50	50/50
本願	袋型	0/50	0/50	0/50	0/50

上掲の表は、いずれも各所定温度に2分間おいた場合に、50個のサンプル中、クラックが発生したものが何個あったかの不良充生率を示す。クラックの充生の有無は、サンプルを切断した断面観察によって行った。このように、本願签置は従来装置に比べ、クラックの発生率が非常に低いことがわかる。

一般に半導体装置は実装時に、Vapor Phase Soldering 、赤外線加熱、半田槽漬け、などの加 熱条件下におかれるが、本顔発明の袋置はこれらの実装時の加熱に十分な耐熱性を有するものとなる。

本発明の製造方法

提いて、第1図に示すような構造をもった半専体装置の製造方法の一実施例を示す。一般に、リードフレームは第5図に示すようなシート材あるいはコイル材などからなる素材100を所定のパターンに加工することによって得られる。第6図に、パターン加工の終了した状態のリードフレーム110は、図の一点類様で示す単位領域111~114を育し、各単位領域はそれぞれ同じパターンを有する。第7図(a) は、この一単位領域111の詳細を示す中面図(一部を省略して示す)であり、同図(b)~(d)は同図(a)のA-A′ 断面図である。

第8回は本免明による半導体装置の製造方法の リードフレーム製造工程の流れ図である。まず、 素材100を洗浄し(ステップS1)、これにレ ジストを塗布、乾燥する(ステップS2.S3)。

この後の工程は従来と同様である。すなわち、このリードフレームをめっきし(ステップS14)、テーピングを行い(ステップS15)、 放鉄検査(ステップS16)を行う。このような 加工を行って得られたリードフレームを用いて、 次にこれにパターンの娘付けを行い(ステップS4)、現象する(ステップS5)。これにより、 素材100上に形成されたレジストにパターンが 転写されたことになる。続いて、残ったレジス トをマスクとしてエッチングを行い(ステップ S6)、レジストを除去すれば(ステップS7)、 第6図に示すようなリードフレーム110が得る れる。ここまでは、従来の加工方法と全く同様で あり、このときのリードフレームの断面は第7図 (b) に示すようになり、焼利郁2a,3aが存在 する。

続くステップS8~Sal3までの工程が、本発明特有の工程となる。この工程により鋭利部2a.3aが除去され、断面凸弧状部20.30が得られる。まず、ステップS7までの工程で得られたリードフレーム110にレジストを壊布、乾燥する(ステップS8.S9)。続いて、パターンの焼付けを行い(ステップS10)、現像する(ステップSS11)。このパターンは、リードフレームのペッドの周辺部およびインナリード部の接

半導体装置を構成すれば、第1図に示すようなク ラックの発生の少ない装置が得られる。

なお、上述の実施例においては、ベッドの周辺 上下縁およびインナリード部のポンディングワイヤとの接続端の上下縁ともに断面凸弧状に形成する場合を示したが、ベッドの周辺上下縁のみを断面凸弧状にしても本発明の効果は得られる。

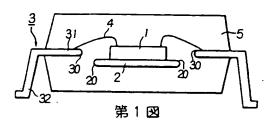
(発明の効果)

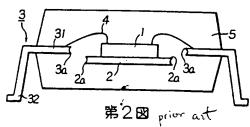
以上のとおり、本発明によれば半導体装置内に 封止されたペッドの周辺上下課、およびインナー リード部の一端の上下練を、断面凸弧状に形成す るようにしたため、鋭利部の存在に起因するクラ ックの発生を抑制することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本允明の一実施例に係る半導体装置の 断面図、第2図は従来の半導体装置の断面図、第 3図は従来の半導体装置におけるクラック発生を 示す断面図、第4図は発生したクラックの拡大図、 第5図はリードフレームを作成するための柔材を 示す斜視図、第6図は一般的なリードフレームの 上面図、第7図は本発明によるリードフレームの 加工工程を示す図、第8図は本発明によるリード フレームの加工工程を示す流れ図、第9図および 第10図は従来の半導体装置についてのクラック 発生試験の結果を示すグラフである。

1…半導体ペレット、2…ベッド、2a…鋭利
部、20…断面凸弧状態、3…リード、3a…鋭 Sharpfull
利部、30…断面凸弧状態、31…インナリード portion
コンナックファイン・カード がいまれる 4…ポンディングワイヤ、5…モールド樹脂、5a…クラック、6…レジスト、100…素材、110…リードフレーム、111…リードフレームの単位新域。





出願人代理人 佐 籐 一 雄

